RESIN COMPOSITION FOR TRANSPARENT THIN MEMBRANE AND ITS CURED MATERIAL

Patent number:

JP2000248052

Publication date:

2000-09-12

Inventor:

IMAIZUMI NAOKO; KITAORI TOMOYUKI

Applicant:

NIPPON KAYAKU KK

Classification:

- international:

C08G59/42; C09D163/00; C09D201/00; G02B5/20

- european:

Application number: JP19990057023 19990304

,

Priority number(s): JP19990057023 19990304

Report a data error here

Abstract of **JP2000248052**

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition excellent in preservation stability, and showing less process soiling in its use and a good working efficiency by containing a compound containing glycidyl group and a compound containing an acid anhydride. SOLUTION: This resin composition is obtained by containing (A) a compound having preferably 5,000-1,000,000 weight-average molecular weight (based on a polystyrene, using a gel permeation chromatography method) and 150-2,000 g/eq epoxy equivalent (JIS K-7236), (e.g.; a high molecular weight epoxy resin) with (B) a compound having preferably 500-500,000 weight-average molecular weight (based on a polystyrene) and containing an acid anhydride in a ratio of (the epoxy equivalent of the component A)/(the acid anhydride equivalent of the component B)=0.2-5. As the component B, a (co)polymer having a compound such as maleic anhydride, itaconic acid anhydride, himic acid anhydride, succinic acid anhydride, etc., as a constituting unit is cited.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-248052 (P2000-248052A)

(43)公開日 平成12年9月12日(2000.9.12)

(51) Int.Cl.7	識別記号	ΡΙ	デーマコート (参考)
C 0 8 G 59/42	2	C 0 8 G 59/42	2H048
C 0 9 D 163/00)	C 0 9 D 163/00	4 J 0 3 6
201/00)	201/00	4 J 0 3 8
G 0 2 B 5/20	101	G 0 2 B 5/20	101

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顯平11−57023	(71)出願人 000004086
		日本化業株式会社
(22)出顧日	平成11年3月4日(1999.3.4)	東京都千代田区富士見1丁目11番2号
		(72) 発明者 今泉 尚子
		東京都北区赤羽北 1 - 15 - 5
	•	(72)発明者 北折 智之
		埼玉県三郷市早稲田8-9-4-301
		Fターム(参考) 2HO48 BB23 BB28 BB37 BB42 BB46
		4J036 AD08 AD21 AF06 AK11 FB04
		JA15
		4J038 CB142 CC022 CC062 CC082
		DB021 DB061 DB071 DB161
•		DB221 KA03 WA14 NA04
		NAO5 NA12 NA14 NA18 PB08
•		

(54) 【発明の名称】 透明薄膜用樹脂組成物及びその硬化物

(57)【要約】

【課題】保存安定性に優れ、工程汚染が極めて少なく、 硬化膜が耐熱性、耐薬品性、耐水性、防染性、密着性に 優れ、LCDやCCDに用いられるカラーフィルターの 製造に有用な透明薄膜用樹脂組成物を提供する。 【解決手段】グリシジル基を有する高分子(A)と酸無

水物を有する高分子(B)を含有する透明薄膜用樹脂組成物。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】グリシジル基を有する高分子(A)と酸無 水物を有する高分子(B)を含有する透明薄膜用樹脂組 成物。

【請求項2】グリシジル基を有する高分子(A)の重量 平均分子量が5.000~1.000.000であり、 エポキシ当量 (WPE) が150~2,000である請 求項1記載の透明薄膜用樹脂組成物。

【請求項3】酸無水物を有する高分子(B)の重量平均 分子量が500~500,000である請求項1又は2 10 に記載の透明薄膜用樹脂組成物。

【請求項4】請求項1乃至3のいずれか一項に記載の透 明薄膜用樹脂組成物の硬化物。

【請求項5】請求項4に記載の硬化物の層を有する固体 摄像索子。

【請求項6】請求項4に記載の硬化物の層を有するカラ ーフィルター。

【請求項7】請求項6に記載のカラーフィルターを有す るカラー液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明薄膜用樹脂組 成物及びその硬化物に関するものであり、特に液晶表示 装置等のカラー化に必要なカラーフィルター、カラーC CD (電荷結合素子)を代表とする固体撮像素子の平坦 化層やその上に設けられるカラーフィルター部の中間 層、保護層を形成する材料として有用な透明薄膜用樹脂 組成物に関するものである。

[0002]

【従来技術】パソコン、カーナビゲーションシステム、 液晶テレビ等のカラー表示に用いるカラー液晶表示装 置、また、カラービデオカメラ、デジタルカメラ、カラ ーコピー機、医療機器の画像処理装置等の入力デバイス として用途の広がる電荷結合素子を代表とする固体撮像 素子には、固体撮像素子表面受光部や回路配線部等によ る凹凸を緩和する目的で平坦化層、カラーフィルターが 設けられている。この平坦化層やカラーフィルターに設 けられる所定の形状にバターニングされたカラー画素上 の保護層、染色法カラーフィルターに於ける混色防止の 為の防染中間層、各カラー画素の表面を保護する目的の 保護層には、透明薄膜が形成されている。

【0003】従来、この様な平坦化層、中間層、保護層 用の樹脂としては、感光性樹脂、エポキシ樹脂等が用い られている。ネガ型感光性樹脂では、低分子モノマーを 紫外線照射して架橋させ不溶化させるが、得られた薄膜 はベースになる材料が低分子である事や架橋密度が充分 得られない事から、又、一方ポジ型感光性樹脂では、架 橋の無い直鎖型髙分子であるので、それらによって得ら れた薄膜の耐熱性、耐薬品性、耐水性や機械的強度等は 通常の熱硬化性樹脂より得られた薄膜より劣る為に、高 50 ーを有するカラー液晶表示装置、に関する。

温蒸着によりIT〇等の透明電極を形成する際に膜の色 変、皺寄りを引き起こし、カラーフィルターの品質を著 しく低下させることがあった。

【0004】又、耐熱性に優れる為広く用いられてきた エポキシ系樹脂としては、硬化剤に低分子量のアミン、 酸無水物、イミダゾール類が使用されているので、これ らの組成物は、ポットライフが短く取り扱いに制約があ る事、又は塗布直前に主剤と硬化剤の2液を混合する必 要があった。又、低分子量の硬化剤が熱硬化時に揮発し ラインやデバイスを汚染してしまう等の工程汚染という 問題が起とり、生産性やコスト面、環境面で多大な悪影 響を及ぼしている。更に、スループット向上の必要性に 伴うポストベイク時間の短縮化により、この組成物でC CDの平坦化膜、カラーフィルターの中間膜、保護膜を 形成した場合、硬化が不十分な為、未反応な硬化剤が、 次工程で溶出してしまう欠点をも抱えている。

【0005】一方、従来の代表的なCCD用染色法カラ ーフィルターは、撮像素子上に平坦化を目的としたポリ マー層を形成後、その上にパターン化した染色層を設け 20 次いで透明な防染中間層を形成させ、その上に同様にし て次の染色層を形成するという工程を繰り返す事により 作成されている。この中間層を形成する樹脂としては、 (メタ) アクリル酸グリシジルと (メタ) アクリル酸2 -ヒドロキシエチル及び桂皮酸クロリド又はその誘導体 の反応物とを、ラジカル共重合させた高分子(特開昭6 1-180235号) や、ポリメチルメタクリレート等 が知られているがこれらから形成した中間層では、前者 高分子では染色層間の混色が生じたり、後者高分子では 染色層との接着性が劣る為に、共に実用性の高い中間層 30 を得ることが出来ない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、保存安定性 に優れ、使用時の工程汚染が極めて少なく、作業性の良 好な透明薄膜用樹脂組成物を提供し、更に耐熱性、耐薬 品性、耐水性、防染性、密着性に優れた透明薄膜用樹脂 組成物の硬化物を提供する事を目的とする。

[0007]

【課題を解決する為の手段】本発明は(1) グリシジル 基を有する高分子(A)と酸無水物を有する高分子

- (B)を含有する透明薄膜用樹脂組成物、(2)(A) が重量平均分子量5,000~1,000,000、エ ポキシ当量 (WPE) が150~2,000である
- (1)記載の透明薄膜用樹脂組成物、(3)(B)が重 量平均分子量500~500,000である(1)又は (2)記載の透明薄膜用樹脂組成物、(4)(1)乃至 (3)のいずれか一項に記載の透明薄膜用樹脂組成物の

硬化物、(5)(4)に記載の硬化物の層を有する固体 撮像素子、(6)(4)に記載の硬化物の層を有するカ ラーフィルター、(7)(6)に記載のカラーフィルタ

[0008]

(発明の実施の形態) 本発明の透明薄膜用樹脂組成物 は、グリシジル基を有する高分子(A)と酸無水物を有 する高分子(B)を含有する。本発明に使用される (A) 成分としては、エチレン性不飽和基とグリシジル 基を有するモノマーの(共)重合体や髙分子量のエポキ シ樹脂が好ましい。(A)成分の重量平均分子量(M ₩)は、ポリスチレン換算で5,000~1,000, 000、好ましくは30,000~500,000であ る。MWの異なる2種以上の(A)成分を組み合わせる 10 以上混合して用いても良い。 ことによって、組成物の粘度を調節することも出来る。 重量平均分子量はゲルバーミエーションクロマトグラフ ィー (GPC) 法により測定される。MWが5.000 未満の場合、硬化膜は耐薬品性、耐水性に劣り実用水準 で使用するのは困難である。MWが1,000,000 を越える場合、硬化膜の機械的強度、耐薬品性、耐水性 は増すものの、樹脂組成物が著しく高粘度となる為に薄 膜化に困難を来す。また、(A)成分のエポキシ当量 (WPE) は、150~2,000g/eqが好まし ポキシ当量は、JIS K-7236の方法で測定され

るエチレン性不飽和基とグリシジル基を有するモノマー としては、例えば (メタ) アクリル酸グリシジル、α-エチルアクリル酸グリシジル、 $\alpha-n-プロピルアクリ$ ル酸グリシジル、 $\alpha - n -$ ブチルアクリル酸グリシジ っル、(メタ) アクリル酸-3, 4-エポキシブチル、 (メタ) アクリル酸-4, 5-エポキシペンチル等のエ ステル部分にグリシジル基を有するアクリル酸エステ ル、アリルグリシジルエーテル、p-ビニル安息香酸グ リシジル、メチルグリシジルイタコナート、エチルグリ シジルマレアート、ビニルグリシジルスルホナート、グ リシジルーβービニルアクリレート、グリシジルソルベ ート等のグリシジルジェンカルボキシレートや、グリシ ジル基を持つジェノフィル化合物とジエン化合物をDi els-Alder反応させる事によって得られる反応

【0009】(A)成分の(共)重合体の構成成分であ

【0010】エチレン性不飽和基とグリシジル基を有す チレン性不飽和基を有するモノマーが挙げられる。具体 的には、例えば、(メタ)アクリル酸アルキルエステ ル、(メタ) アクリル酸ジシクロペンタニル、フマル酸 アルキルエステル、スチレン、α-アルキルスチレン、

性モノマー等が挙げられる。

アクリロニトリル、イソブチレン、ブタジエン、イソブ レン、酢酸ビニル、ジビニルブチラール等が挙げられ

【0011】(A)成分の高分子量のエポキシ樹脂とし ては、例えばビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフ ェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキ シ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエーテ ル系エポキシ樹脂が挙げられる。

【0012】これら(A)成分は、単独で用いても2種

【0013】これらの内、本用途の要求特性である透明 性、耐熱変色性、染色時防染性に優れるものとして特に 好ましい高分子としては、(メタクリル酸グリシジル) - (メタクリル酸アルキルエステル) 共重合体、(メタ クリル酸グリシジル)-(スチレン)共重合体、(メタ クリル酸グリシジル)-(メタクリル酸アルキルエステ ル) - (スチレン) 共重合体である。アルキル鎖の炭素 数は、 $1 \sim 8$ 個、好ましくは $1 \sim 3$ 個である。この化合 物の例としては、マーブルーフG-2050M、G-8 く、更に好ましくは150~750g/eqである。エ 20 70S、G-1010S、ブレンマーCP-510SA (何れも日本油脂製、商品名)等がある。

【0014】本発明に使用される(B)成分としては、 マレイン酸無水物、イタコン酸無水物、ハイミック酸無 水物、コハク酸無水物、シトラコン酸無水物、アクリル 酸無水物、メタクリル酸無水物等より1種又は2種以上 選択される化合物を構成単位とする (共) 重合体が挙げ られる。又、これらと共重合可能な不飽和二重結合を有 する化合物としては、エチレン類、プロビレン類、ブテ ン類、ブタジエン類、高級オレフィン類、スチレン類、 30 スチルベン類、酢酸ビニル、アリルエーテル、1-メチ ルシクロプロペン、環状ジエン化合物、ジシクロジエン 化合物等が挙げられ、交互性の良好な共重合体が得られ る。又、三級水素を持つポリエンポリマーとマレイン酸 無水物、ピロメリット酸無水物、トリメリット酸無水 物、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、メタクリ ル酸無水物、エチレングリコールビストリメリテート、 グリセリントリストリメリテート等の酸無水物を反応さ せて酸無水物構造を導入した高分子化合物が挙げられ る。例えば、下記化学式(1)の化合物(工化,70, るモノマーと共重合可能なモノマーとしては、例えばエ 40 1432, '67)、下記化学式(2)の化合物(Pu re Appl. Chem., 34, 305, '73) を挙げることが出来る。

[0015]

【化1】

 $R;CH_3,C_2H_5,C_6H_5,CI$

【0016】(B)成分の重量平均分子量(MW)は、 は500~300,000である。

【0017】 これら(B) 成分は、単独で用いても2種 以上混合して用いても良い。

【0018】本発明の透明薄膜用樹脂組成物の(A)、

(B) 成分の配合量は、硬化物の物性から配合比を決定 しても良いが、(A)のWPEと(B)の無水酸当量の 関係が、WPE/無水酸当量=0.2~5の範囲が好ま しい。(A)成分に対し(B)成分の配合量が極端に少 ないと、硬化物に充分な硬度が得られなかったり、機械 衝撃性が低下する等の問題を生ずる。一方、(A)成分 30 に対し(B)成分の配合量が極端に多い場合、酸無水物 が大気中の水分を吸湿し易く、硬化不足の傾向を来す 他、硬化物の白濁等不具合を生ずる為、適当でない。

【0019】本発明の透明薄膜用樹脂組成物は必要によ り、硬化促進剤としてポリアミド類、メラミン誘導体を 添加しても良い。使用量は加熱硬化時に大量揮発しない 程度であることが好ましく、(A)、(B)合計固形分 に対し10%以下が好ましい。

【0020】本発明の透明薄膜用樹脂組成物は、溶媒に 溶解させた塗布液として調製するのが好ましい。用いる 溶媒としては樹脂組成物と化学反応を起こす恐れが無い 限り特に制限はなく、例えばエステル系、エーテル系、 ケトン系、芳香族炭化水素系等の有機溶剤が挙げられ る.

【0021】具体的には、酢酸アルキルエステル、プロ ビオン酸アルキルエステル、酪酸アルキルエステル等の 飽和脂肪族モノカルボン酸アルキルエステル類、乳酸ア ルキルエステル類、アルコキシ酢酸アルキルエステル 類、2-オキシプロピオン酸アルキルエステル類、2-

シブロピオン酸アルキルエステル類、3-アルコキシブ ポリスチレン換算で500~500,000、好ましく 20 ロピオン酸アルキルエステル類、2-オキシー2-メチ ルプロピオン酸アルキルエステル類、2-アルコキシー 2-メチルプロピオン酸アルキルエステル類、ピルビン 酸アルキルエステル、アセト酢酸アルキルエステル、2 オキソブタン酸アルキルエステル等のケトン酸エステ ル類、ジアルキルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオ キサン等のエーテル類、ジエチレングリコールモノメチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエ ーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテ ル、プロビレングリコールモノメチルエーテル、プロビ レングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエー テル類及びそのアセテートのグリコールエーテルアセテ ート類、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、2-ヘブタノン、3-ヘプタノン等のケトン類、キシレン、 トルエン等の芳香族炭化水素類等が挙げられる。これら 溶媒は、単独で用いても2種以上混合して用いても良 61

【0022】本発明の透明薄膜用樹脂組成物を調製する 際、塗膜の物性を向上させる為に、表面平滑剤、基板密 着改良材、界面活性剤等の調整添加剤を加えても良い。 具体的には、パーフルオロアルキル系化合物、シリコン 系化合物、ポリオキシエチレン化合物、ポリオキシプロ ピレン系化合物、長鎖アルキル化合物等が挙げられる。 【0023】本発明の透明薄膜用樹脂組成物を調製する には、例えば上記溶剤中に(A)、(B)成分を、更に 所望により硬化促進剤や添加剤を加え、均一に混合溶解 すればよい。溶液中の(A)成分と(B)成分の合計濃 アルコキシプロピオン酸アルキルエステル類、3-オキ 50 度は、3~30重量%、好ましくは、5~20重量%程 度である。

【0024】本発明の硬化物は通常、所定の基材に塗布し、加熱焼成することによって、膜厚0.05~5μm程度の透明薄膜として形成される。透明薄膜を形成すべき基材としては、例えば、硝子類、ボリカーボネート類、フィルム類、撮像素子の形成されたシリコンウェハー、LCD又はCCD用カラーフィルターのパターン化された着色樹脂膜、印刷用紙、印刷用繊維、金属板等が挙げられる。塗工方法としては、樹脂組成物溶液を目的の基材上に、スピンコート法、ロールコート法、バーコート法、印刷法、浸漬法、スプレイ法等の方法で塗布する。続いて、60~120℃に設定されたホットプレート又はコンベクションオーブンにて1~10分程度予備乾燥後、180~250℃にて3~30分程度加熱焼成し、硬化膜を得る。

【0025】本発明のカラーフィルターは、上記組成物の硬化膜を有する。このカラーフィルターは、カラー液晶表示装置、カラーCCDに用いられる。液晶表示装置用カラーフィルターの製造は、公知の方法で行われる。例えば、硝子基板上にフォトリングラフィー法、印刷法、電着法等によって、赤、青、緑の着色画素及びブラックマトリクスを作成後、その上に透明保護膜を形成し、更にITOの透明導電膜(電極)を費層することによって得られる。このカラーフィルターを表示面に配置することにより、本発明のカラー液晶表示装置が得られる。

【0026】本発明の固体撮像素子は、撮像素子の形成されたシリコンウェハーに、直接もしくは他の層を介して上記の透明薄膜用樹脂組成物の硬化物の層を設けたものである。その製法は、予め硝子基板上に上記の透明薄 30 膜用樹脂組成物の硬化物の層を有するカラーフィルターを形成してれをチップサイズに切断してCCDチップ上に位置合わせ後、接着剤で貼り合わせる方法と、光電変換素子や電荷転送素子等で成る固体撮像装置が形成されたシリコン基板上に、シリコンウェハー表面の凹凸の平*

* 滑化の為に上記の透明薄膜用樹脂組成物の硬化物の層を 形成し、次に染色法又は顔料分散フォトリソグラフィー 法等によって直接カラーフィルターを形成し、カラーフィルター完成後チップに切断するオンチップ法がある。 位置合わせ精度、量産性に優れる後者の製造方法が主流 となっている。前者の方法に於けるカラーフィルター は、LCD用カラーフィルターの製法と同様である。後 者の製法は、まずシリコンウェハー表面の凹凸の平滑化 の為に透明薄膜を形成し、次に染色法でカラー画素を作 成する場合は各色染色後に防染目的の透明薄膜を形成 し、最後のカラー画素染色後に透明薄膜によって保護層 を設けることによってCCDのカラーフィルターが完成 する。

【0027】本発明の透明薄膜用樹脂組成物は、上記の様にして加熱処理をする事によって、前配(A)成分と(B)成分とが架橋し合い超高分子量化する為、得られた透明薄膜は、耐熱性、耐薬品性、耐水性、耐染色性、密着性に優れており、LCD用カラーフィルター等の着色樹脂膜の保護層、又はCCDの平坦化層、及び中間層及び保護層の形成に際し特に有用となる。又、低分子化合物を含まないので、揮発、溶出等工程汚染が極めて少ない信頼性の高い透明薄膜を得、これによって得られたカラーフィルターを使用した液晶表示装置、固体撮像素子は優れた表示品位を確保する事が出来るのである。【0028】

【実施例】実施例によって本発明を更に具体的に説明するが、本発明がこれらの実施例のみに限定されるものではない。

【0029】実施例1~10

30 表1に示す(A)群の共重合高分子化合物と、(B)群の高分子化合物を各々表2に示す比でプロビレングリコールモノメチルエーテルアセテートに固形分11重量%となるように溶解し透明薄膜用樹脂組成物を調製した。 【0030】

表1

	(A)群	MW	WPE		(B)群	MW
a l	G-2050M	225,000	340	b l	GSM-1001	10,000
a 2	-CMA-MMA-	100,000	240	b 2	GSM-6001	60,000
a 3	-CMA-BMA-	300,000	1000	ь3	GSM-10001	100,000
a 4	-CMA-AN-	150,000	500	b 4	式(1)	50,000
a 5	-QMA-ST-	400,000	2500	b 5	式(2)	25,000

【0031】但し、GMA;グリシジルメタクリレート、MMA;メチルメタクリレート、G-2050M;GMA-MMA共重合体(日本油脂製、商品名)、BMA;ブチルメタクリレート、AN;アクリロニトリル、ST;スチレン、GSM-1001;スチレンーマレイン酸無水物1:1共重合体(岐阜セラック製、商品

※名)、GSM-6001;スチレン-マレイン酸無水物 1:1共重合体(岐阜セラック製、商品名)、GSM-10001;スチレン-マレイン酸無水物1:1共重合 体(岐阜セラック製、商品名)を表す。

[0032]

表2

実施例 al a2 a3 a4 a5 bl b2 b3 b4 b5

(6) 10 9 3 l 10 2 10 2 3 10 3 4 10 2 5 10 10 2 6 7 10 3 2 10 8 9 10 3 3 10 10 (固形重量比)

【0033】この各種透明薄膜用樹脂組成物により得ら れた硬化膜の耐溶剤性、耐水性、耐熱性、色被り、残渣 汚染の評価を以下に記すように行った。評価結果を表5 に示す。

【0034】透明薄膜用樹脂組成物の硬化膜の作成例 ガラス基板上に最終膜厚0.5μmとなるよう塗布し、 表面温度100°Cのホットプレート上で100秒間予備 乾燥後、200℃のホットプレート上で5分間加熱し、 透明薄膜を得た。これを各種試験片とする。

【0035】耐溶剤性:上記試験片を、下記溶剤に各種 条件で処理、試験前後の膜厚を測定し残膜率を求め、膜 面を光学顕微鏡で観察した。

Φ60℃IPA (イソプロパノール) 蒸気×20分曝露 ②50℃NMP(N-メチルピロリドン)×20分浸漬 **③**50℃GBL (γ-ブチロラクトン)×20分浸漬 【0036】耐水性:純水の入ったプレッシャークッカ -試験(PCT)用容器に上記試験片を入れ130℃に て3時間処理を行い、膜面を光学顕微鏡で観察した。

【0037】耐熱性:上記試験片を、250℃のホット*30 【0040】

*プレートで60分間加熱処理し加熱前後の着色度(AE *ab値:色度差)を分光光度計にて測定した。

【0038】色被り、残渣汚染:上記の透明薄膜上に、 顔料分散カラーネガレジストKAYAMIRROR D CF-G630 (緑色顔料レジスト:日本化薬製、商品 名)を約1μm相当膜厚に塗布し、80℃のホットプレ ート上で100秒間プレベイク後、紫外線未照射のまま KAYAMIRROR DVL-T50D(有機アルカ 20 リ系現像液;日本化薬製、商品名)にて全面現像し、水 洗乾燥後透明薄膜上への色被り(ΔE*ab値)を分光 光度計にて測定した。又、残渣汚染を顕微鏡にて評価し た。

【0039】比較例1~3

表3に示す熱硬化性樹脂と硬化剤を組み合わせた透明薄 膜用樹脂組成物として、表4に示す配合比で固形分11 重量%となるように溶媒に溶解した。耐溶剤性、耐水 性、耐熱性、色被り、残渣汚染の評価を上記と同様に行 った。評価結果を表5に示す。

熱硬化性樹脂 _CMA_MMA_ c l

硬化剤 MWWPE 100,000 240 d l 無水トリメリット

酸 c2 -CMA-MMA-

テトラヒドロ無水 d 2 225,000 340

フタル酸

表3

c3 -MAA-(N-フェニルマレイミド)-10,000 300 d 3 IRGANOX 3114

【0041】但し、IRGANOX3114;トリスー ※-イソシアヌレート(チバガイギー製、商品名) (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル) ※40 【0042】

表4

比較例 c 2 c 3 d l d 2 d 3 c l 1 10 2 10 1.5 3 10 0.5 1 (固形重量比)

[0043]

表5

耐溶剤性(残膜率) 耐水 耐熱 色被り △ * ab △E* ab 残渣 **GBL** PCT

12

11

	•	•	1	無し
. :	2 (^		
		υ.	I	無し
١. :	3 (0.	1	無し・
١. ٠	4 (0.	1	無し
	1 (Э.	l	無し
٠. :	2 (Э.	1	無し
. :	2 (Э.	l	無し
. 8	3 3	3.	5	有り
. 1	7 5	5 .	7	有り
		. 3 (4 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	. 3 0. . 4 0. . 1 0. . 2 0. . 2 0.	. 3 0. 1 . 4 0. 1 . 1 0. 1 . 2 0. 1 . 2 0. 1

77% 70% 72% 白化 2.0 6.8 有り

【0044】実施例11

上記の透明薄膜用樹脂組成物を、撮像素子の配設された シリコンウェハー上に最終膜厚0. 3μmとなるよう塗 布し、表面温度100℃のホットプレート上で100秒 間予備乾燥後、200℃のホットプレート上で5分間加 熱し、下地平坦化膜を得た。この下地平坦化膜上に、顔 料分散カラーネガレジストKAYAMIRROR DC F-G630 (緑色顔料レジスト;日本化薬製、商品 名)を約1µm相当膜厚に塗布し、80℃のホットプレ 20 ート上で100秒間プレベイク後、所定のパターンフォ トマスクを介して150mJ(365nm)の紫外線を 照射した。続いてKAYAMIRROR DVL-T5 0D(有機アルカリ系現像液;日本化薬製、商品名)に て現像、水洗乾燥後、200℃のホットプレート上で5 分間ポストベイクし緑色微細画素を形成した。次いで、 顔料分散カラーネガレジストKAYAMIRROR D o CF-R630 (赤色顔料レジスト;日本化薬製、商品 名)を約1µm相当膜厚に塗布し、80℃のホットプレ ート上で100秒間プレベイク後、所定のパターンフォ 30 トマスクを介して150mJ (365nm) の紫外線を 照射した。続いてKAYAMIRROR DVL-T5 0D(有機アルカリ系現像液:日本化薬製、商品名)に て現像、水洗乾燥後、200℃のホットプレート上で5 分間ポストベイクし赤色微細画素を形成した。次いで、 顔料分散カラーネガレジストKAYAMIRROR D CF-B630 (青色顔料レジスト: 日本化薬製、商品 名)を約1µm相当膜厚に塗布し、80℃のホットプレ ート上で100秒間プレベイク後、所定のパターンフォ 照射した。続いてKAYAMIRROR DVL-T5 0D(有機アルカリ系現像液:日本化薬製、商品名)に て現像、水洗乾燥後、200℃のホットプレート上で5

分間ポストベイクし赤色微細画素を形成し、カラーフィ ルターが直付けされた固体撮像素子が得られた。これを 顕微鏡により直上から観察したところ、下地平坦化膜上 への色被り、残渣汚染は全く認められなかった。

【0045】実施例12

ガラス基板上に、顔料分散カラーネガレジストKAYA MIRROR DCF-R630, DCF-G630, DCF-B630(赤、緑、青色顔料レジスト: 日本化 薬製、商品名)を用いて実施例11と同様の方法で赤、 緑、青の画素をバターン形成した着色樹脂膜上に、実施 例1~10の透明薄膜用樹脂組成物により、保護膜とし て透明薄膜を形成し、LCD用カラーフィルターを作成 した。各保護膜の密着性をクロスカット剥離試験によっ て評価したところ、何れも剥離数0/100で強固な密 着性を確認した。又、とれらのカラーフィルター上に2 50℃にて30分かけITOの蒸着操作を施したが、何 れも皺寄り現象は見られなかった。

[0046]

【発明の効果】本発明の透明薄膜用樹脂組成物を使用す ることにより、耐熱性、耐薬品性、耐水性、耐染色性、 密着性に優れた透明薄膜を簡便に製造することが出来 る。LCD用カラーフィルターの着色樹脂膜の保護層、 又はCCDの平坦化層、及び中間層及び保護層の形成に 際し特に有用である。又、当該樹脂組成物の熱硬化時 や、後工程での工程汚染が極めて少ないので、低コスト で信頼性の高い透明薄膜を得ることが出来、得られたカ ラーフィルター、固体撮像素子は優れた表示品位を確保 する事が出来る。又、との透明薄膜を設けたカラーフィ トマスクを介して150mJ(365nm)の紫外線を 40 ルターは、優れた光学特性及び電気特性を有し、このカ ラーフィルターを用いることによって、高品質なカラー 表示装置や固体撮像素子を提供することが出来る。

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-248052

(43)Date of publication of application: 12.09.2000

(51)Int.CI. C08G 59/42 C09D163/00 C09D201/00 G02B 5/20

(21)Application number : 11-057023

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

04.03.1999

(72)Inventor: IMAIZUMI NAOKO

KITAORI TOMOYUKI

(54) RESIN COMPOSITION FOR TRANSPARENT THIN MEMBRANE AND ITS CURED MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition excellent in preservation stability, and showing less process soiling in its use and a good working efficiency by containing a compound containing glycidyl group and a compound containing an acid anhydride.

SOLUTION: This resin composition is obtained by containing (A) a compound having preferably 5,000–1,000,000 weight-average molecular weight (based on a polystyrene, using a gel permeation chromatography method) and 150–2,000 g/eq epoxy equivalent (JIS K-7236), (e.g.; a high molecular weight epoxy resin) with (B) a compound having preferably 500–500,000 weight-average molecular weight (based on a polystyrene) and containing an acid anhydride in a ratio of (the epoxy equivalent of the component A)/(the acid anhydride equivalent of the component B)=0.2–5. As the component B, a (co)polymer having a compound such as maleic anhydride, itaconic acid anhydride, himic acid anhydride, succinic acid anhydride, etc., as a constituting unit is cited.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the 'original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The resin constituent for transparence thin films containing the macromolecule (A) which has a glycidyl group, and the macromolecule (B) which has an acid anhydride.

[Claim 2] The resin constituent for transparence thin films according to claim 1 whose weight per epoxy equivalent (WPE) the weight average molecular weight of the macromolecule (A) which has a glycidyl group is 5,000-1,000,000, and is 150-2,000.

[Claim 3] The resin constituent for transparence thin films according to claim 1 or 2 whose weight average molecular weight of the macromolecule (B) which has an acid anhydride is 500-500,000.

[Claim 4] The hardened material of the resin constituent for transparence thin films given in claim 1 thru/or any 1 term of 3.

[Claim 5] The solid state image sensor which has the layer of a hardened material according to claim 4.

[Claim 6] The color filter which has the layer of a hardened material according to claim 4.

[Claim 7] The color liquid crystal display which has a color filter according to claim 6.

[Translation done.]

· NOTICES ·

JPO and NCIP1 are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the resin constituent for transparence thin [Field of the Invention] This invention relates to the resim construent for unsparence of films useful as an ingredient which forms the interlayer of the color filter section prepared the flattening layer of a color filter required for especially colorization of a liquid crystal display etc., and the solid state image sensor which makes a color CCD (charge-coupled device) representation, and on it, and a protective layer about the resin constituent for transparence thin films, and its hardened material.

[Description of the Prior Art] The flattening layer and the color filter are prepared in the solid (Description or the Prior Art) In nattening layer and the close rites are prepared in the sound state image sensor which makes representation the charge-coupled device in which an application spreads as input devices, such as an image processing system of the color liquid crystal display used for color displays, such as a personal computer, a carmavigation system, and a liquid crystal television, and a color video camera, a digital camera, a color copier, and medical equipment, in order to ease the irregularity by the solid state image sensor surface light aemain portion, the circuit wiring section, etc. The transparence thin film is formed in the resist-printing interlayer for the color mixture prevention in the protective layer on the color locked by which natterning was carried out to the predetermined confliquation prepared in this pixel by which patterning was carried out to the predetermined configuration prepared in this flattening layer and color filter, and a staining technique color filter, and the protective layer

flattering layer and color filter, and a starring technique color filter, and the protective layer to protect the front face of each color pixel.

[0003] Conventionally, the photopolymer, the oppox resin, etc. are used as resin for such a flattening layer, an interlayer, and protective layers. Although carry out UV irradiation of the low-molecular monomer, it is made to construct a bridge and is made to insolubilize in a negative-mold photopolymer. On the other hand from neither the ingredient which becomes the base being low-molecular, nor crosslinking density being obtained enough, the obtained thin film in a positive type photopolymer. The thermal resistance of the thin film obtained by them since it was a straight chain mold macromolecule without bridge formation. Since it was them since it was a straight chain mold macromolecule without bridge formation, Since it was inferior to the thin film obtained from usual thermosetting resin, in case chemical resistance, a water resisting property, a mechanical strength, etc. form transparent electrodes, such as ITO, by elevated-temperature vacuum evaporatione, they cause membranous color queerness and wrinkle approach, and might reduce the quality of a color filter remarkably.

and wrinkle approach, and might reduce the quality of a color hiter remarkably. [0004] Moreover, since it excelled in thermal resistance and the amine of low molecular weight, an acid anhydride, and imidazole derivatives were used for the curing agent as epoxy system resin used widely, these constituents needed to mix 2 liquid of base resin and a curing agent just before that pot life is short and handling has constraint or spreading, Moreover, the curing agent of low molecular weight volatilized at the time of heat curing, the problem of curing agent of low molecular weight votatized at the time of neat curing, one protein or process contamination of polluting Rhine and a device aroas, and the great bad influence is done in respect of productivity, cost, and an environment. Furthermore, by shortening of the postbake time amount accompanying the need for the improvement in a throughput, when the flattening film of CCD, the interlayer of a color filter, and a protective coat are formed with this constituent, since hardening is inadequate, the fault in which an unreacted curing agent is eluted at degree process is also held. [0005] On the other hand, the conventional typical staining technique color filter for CCD is

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/09/26

JP,2000-248052,A [DETAILED DESCRIPTION]

3/8 ページ

glycidyl group are mentioned.
[0010] The monomer which has an ethylene nature partial saturation radical, for example as the monomer and the monomer which can be copolymerized which has an ethylene nature partial saturation radical and a glycidyl group is mentioned. Specifically, acrylic-acid (meta) alkyl ester, acrylic-acid (meta) dicyclopentanii, fumari-acid alkyl ester, styrene, shpha-alkyl styrene, acrylonitrile, an isobutylene, a butadiene, an isoprene, vinyl acetate, divinyl butyral.

[0011] (A) As an epoxy resin of the amount of giant molecules of a component, the bisphenol A mold epoxy resin, a biaphenol female mold epoxy resin, a bisphenol smooth S form epoxy resin, a novolak mold epoxy resin, and a glycidyl ether system epoxy resin are mentioned, for

(0012) These (A) components may be used independently, or two or more sorts may be mixed

and they may be used.
[0013] As the transparency which is the demand characteristics of this application,
thermochromism, and a giant molecule especially desirable as what is excellent in resistprinting nature at the time of dyeing, they are a (glycidyl methacrylate)-catyrene) copolymer, and (glycidyl methacrylate
ester) copolymer, a (glycidyl methacrylate)-(styrene) copolymer, and (glycidyl methacrylate)
among these. -(alkyl methacrylate ester)- (styrene) It is a copolymer. I-8 carbon numbers of
an alkyl chain are I-3 pieces preferably. As an example of this compound, there are MAPU
roof G-2050M, G-870S, G-1010S, BUREMMA CP-510SA (all are the Nippon Oil & Fats make id a trade name), etc.

and a trade name), etc. (2014) As a (B) component used for this invention, the polymer which makes a configuration unit one sort or the compound chosen two or more sorts from a maleic-acid anhydride, an itaconic-acid anhydride, himic acid anhydride, a succinic-acid anhydride, a citraconic anhydride, an acrylic-acid anhydride, are citraconic anhydride, as a compound which has the partial saturation double bond in which these and copolymerization are possible, ethylene, propylenes, butene, butadienes, high-class olefins, styrene, stilbenes, vinyl acetacte, the allyl compound ather, 1-methyl cyclopropene, an annular diene compound, a JISHIKURO diene compound, etc. are mentioned, and the good copolymer of alternation nature is obtained. Moreover, the high molecular compound which acid anhydride, promellitic acid anhydride, trimellitic anhydride, a benzophenone tetracarboxytic acid anhydride, a pyromellitic acid anhydride, trimellitic anhydride, a benzophenone tetracarboxytic acid anhydride, anhydride, and ethylene glycol bisttrimellitate), and glycerin tris (trimellitate), were made to react, and introduced acid-anhydride structure is mentioned. For example, the compound (*v=-zing, 70 and 1432, '67) of the following chemical formula (1) and the compound (*v=-zing, 70 and 1432, '67) of the following chemical formula (2) can be mentioned.

[0015]

created after forming the polymer layer aiming at flattening on an image sensor by repeating the process of preparing the dyeing layer patternized on it, making a resist-printing interlayer transparent subsequently forming, and forming the following dyeing layer similarly on it. As resin which forms this middle class, the reactant of metaglycidyl scrylate (meta), scrylic-acid (meta) 2-hydroxyethyl and cinnamic acid chloride, or its derivative in the giant molecule (JP,81-18025A) which carried out radical copolymerization, and the interlayer who formed from these although polymethylmethacrylate etc. was known in a former macromolecule, since the color mixture between dyeing layers arises or an adhesive property with a dyeing layer is inferior in a latter macromolecule, the high interlayer of both practicality cannot be obtained. [0006]
[Problem(3) to be Solved by the Instantical Training on an image sensor by repeating interlayer of both practicality cannot be obtained.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention is excellent in preservation stability. there is very little process contamination at the time of use, it offers the good resin constituent for transparence thin films of workability, and aims at offering the hardened material of the resin constituent for transparence thin films which was further excellent thermal resistance, chemical resistance, a water resisting property, resist-printing nature, and

[Means for Solving the Problem] The resin constituent for transparence thin films with which this invention contains the macromolecule (A) which has (1) glycidyl group, and the macromolecule (B) which has an acid anhydride, The resin constituent for transparence thin macromolecule (8) which has an acid arhydride, the result constituent for transparence trinfilms given in (1) (2) and (A) are { weight average molecular weight 5,000-1,000,000 and given weight per epoxy aquivalent (WPE) 1 150-2,000, (1) (3) and whose (8) are weight average molecular weight 500-500,000, or the result constituent for transparence thin films given in (2), (3), (1), or the hardened material of the result constituent for transparence thin films given in any 1 term of (3), it is related with the solid state image sensor which has the layer of the hardened material of a publication in (5) and (4), the color filter which has the layer of the hardened material of a publication in (6) and (4), the color filter which has the layer of the hardened material of a publication in (6) and (4), and the color liquid crystal display which has the solid filter of a publication in (7). the color filter of a publication in (7) and (6).

the color filter of a publication in (7) and (8). [1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[1008]
[

http://www4.ipdl.ncipi.go.ip/cgi-bin/tran_web_cgi_eije

2005/09/26

JP,2000-248052,A [DETAILED DESCRIPTION]

4/8 ページ

[0018] (B) the weight average molecular weight (MW) of a component — polystyrene conversion — 500-500,000 — it is 500-300,000 preferably.

[0017] These (B) components may be used independently, or two or more sorts may be mixed

and they may be used. [0018] Although (A) of the resin constituent for transparence thin films of this invention and (0)18] Although (A) of the resin constituent for transparence thin films of this invention and the loadings of the (B) component may determine a compounding railo from the physical proporties of a hardened material, the range of WPE/acid arrhydride equivalent = 2.75 has WPE of (A), and the desirable relation of the acid arrhydride equivalent of (B). (A) To a component, if there are a streemely few loadings of the (B) component, sufficient degree of hardness for a hardened material will not be obtained, or the problem of machine impact nature falling will be produced. On the other hand, since an acid anhydride tends to absorb moisture the moisture in atmospheric sir when there are extremely many loadings of the (B) component, the inclination for hardening to be insufficient is caused to the (L. Jomponent and also faults, such as nebula of a hardened material, are produced, it is not sui* le. [0019] As occasion demands, the resin constituent for transparence thin film: of this invention may add polyamides and a melamine derivative as a hardening acc - stor. As for the amount used, it is desirable that it is extent which does not carry out extensive volatilization at the time of heat hardening, and it is desirable to (A) and (B) sum total solid content. [105 or leas of]
[0020] As for the resin constituent for transparence thin films of this invention, it is desirable to proper as accosting liquid dissolved in the solvent. As long as there is no - vesibility of

[UUZU] As for the resun construent for transparence than time of this trendment, it is desirable to prepare as coating liquid dissolved in the solvent. As long as there is no satisfied of causing a resin constituent and a chemical reaction as a solvent to be used, there is especially no limit, for example, organic solvents, such as an exter system, an ether system, a

caspacially no limit, for example, organic solvents, such as an ester system, an ether system, a ketone system, and an aromatic hydrocarbon system, are mentioned. [0021] Specifically Acetic-racid alkyl ester, propionic-racid alkyl ester. Saturation aliphatic series monocarboxylic acid alkyl ester, such as butanoic acid alkyl ester. Alkoxy propionic-racid alkyl ester and 3-roxy-propionic-racid alkyl ester and 3-roxy-propionic-racid alkyl ester 3-alkoxy propionic-racid alkyl ester and 3-roxy-propionic-racid alkyl ester 3-alkoxy propionic-racid alkyl ester, a terminal propionic-racid alkyl ester, such as betanoic acid alkyl ester and 3-roxy-propionic-racid alkyl ester. Boxy-propionic-racid alkyl ester, and alkyl ester and 2-roxy-butanoic acid alkyl ester. Koto acid ester, such as acetoacetic-racid alkyl ester and 2-roxy-butanoic acid alkyl ester. Boxy-propionic-racid alkyl ester and 3-roxy-propionic-racid alkyl ester and 5-roxy-propionic-racid alkyl ester. Boxy-propionic-racid alkyl ester and 5-roxy-propionic-racid alkyl ester and 5-roxy-propionic-racid alkyl ester. Boxy-propionic-racid alkyl ester and 5-roxy-propionic-racid alkyl ester and 5-roxy-propionic-racid alkyl ester. Boxy-propionic-racid alkyl ester and 5-roxy-propionic-racid alkyl ester. Boxy-propionic-racid alkyl ester.

be used.
[0022] In case the resin constituent for transparence thin films of this invention is prepared, in order to raise the physical properties of a paint film, adjustment additiver, such as a surface lubricating agent, substrate adhesion amelioration material, and a surfactant, may be added. Specifically, a perfluoroalkyl system compound, a silicon system compound, a polyoxyethylene compound, a polyoxypropylene system compound, a long-chain alkyl und, etc. are mentioned.

compound, etc. are mentioned. [0023] What is necessary is to add a hardening accelerator and an additive by request further, and just to carry out the mixed dissolution of (A) and the (B) component into the abovermentioned solvent, at homogeneity, in order to prepare the resin constituent for transparence thin films of this invention. The sum density of the (A) component in a solution and the (B) component is about 5 - 20 % of the weight preferably three to 30% of the weight.

[0024] The hardened material of this invention is applied to a predetermined base material, and is usually formed by carrying out heating baking as a transparence thin film of about 0.05-5 micrometers of thickness. The coloring resin film with which the silicon wafer with which sides on wafer with which sides, polycarbonates, films, and an image sensor were formed LCD, or the color filter for CCD was patternized as a base material which should form a transparence thin film, for example, a print sheet, the fiber for printing, a metal plate, etc. are mentioned. As the coating approach, a resin constituent solution is applied on the target base omaterial by approaches, such as a spin coat method, the roll coat method, the bar coat method, print processes, dip

such as a spin coat method, the roll coat method, the bar coat method, print processes, dip coating, and a spray method. Then, heating baking is carried out about 3 to 30 minutes at 180-250 degrees C after predrying about 1 to 10 minutes with the hot plate or convection oven set as 50-120 degrees C, and the hardening film is obtained. (9025) The color filter of this invention has the hardening film of the abover-mentioned constituent. This color filter is used for a color liquid crystal display and a color CCD. Manufacture of the color filter for liquid crystal displays is performed by the well-known approach. For example, the red, blue, green coloring pixel, and black matrix creation-back is formed on a glass substrate, a transparence protective coat is formed on it with the photolithography method, print processes, an electrodeposition process, etc., and it is obtained by carrying out the laminating of the transparence electric conduction film (electrode) of ITO further. By arranging this color filter to the screen, the color liquid crystal display of this invention is obtained. fisplay of this invention is obtained.

display of this invention is obtained.

[9026] The solid state image sensor of this invention prepares the layer of the hardened material of the above-mentioned resin constituent for transparence thin films in the silicor wafer with which the image sensor was formed through direct or other layers. How for the process to form beforehand the color filter which has the layer of the hardened material of process to form beforehand the color filter which has the layer of the hardened material of the abover-mentioned resin constituent for transparence thin films on a glass substrate, cut this to a city size, and stick with adhesives after alignment on a CCD chip. On the silicon substrate in which the solid state camera which changes by the optoelectric transducer, a charge coupled device, etc. was formed The layer of the hardened material of the abover-mentioned resin constituent for transparence thin films is formed for smoothing of the irregularity on the front face of a silicon wafer, next, a direct color filter is formed by the staining technique or the pigment-content powder photolithography method, and there is the method on chip cut for the chip after color filter completion. The manufacture approach of the latter which is excellent in alignment precision and mass-production nature is in use. The color filter in the former approach is the same as that of the process of the color filter for LCD. The latter process forms a transparence thin film first for smoothing of the irregularity on the front face of a silicon wafer, when creating a color pixel by the staining technique next.

LCD. The latter process forms a transparence thin film first for smoothing of the irregularity on the front face of a silicon wafer, when creating a color pixel by the staining technique next, it forms the transparence thin film for the purpose of resist printing after each color dyeing color, and the color filter of CCD completes it by preparing a protective layer with a transparence thin film after the tast color pixel dyeing.

[0027] Since the aforementioned (A) component and the (B) component construct a bridge for each other and the resin constituent for transparence thin films of this invention ultrahigh-molecular-weight-izes by heat-treating as mentioned above, the obtained transparence thin film is excellent in thermal resistance, chemical resistance, a water resisting property, a dye affinity-proof, and adhesion, and becomes useful especially on the occasion of formation of the protective layer of coloring resin film, such as a color filter for LCD, or the flattening layer of CCD, an interlayer, and a protective layer. Moreover, since a low molecular weight compound is not included, the figuid crystal display which used the color filter with which process contamination, such as a volatilization and elution, obtained the transparence thin film with very little high dependability, and was obtained by this, and the solid state image sensor can socure the outstanding display grace. sensor can secure the outstanding display grace.

[Example] Although an example explains this invention still more concretely, this invention is

not limited only to these examples.
[0029] It dissolved so that it might become propylene-glycol-monomethyl-ether acetate with

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/09/26

JP,2000-248052,A [DETAILED DESCRIPTION]

7/8 ベージ

Lable 3 Thermosetting resin MW WPE Curing agent c1 -GMA-MMA- 100,000 240 d1 Trimollitic arhydride c2 -GMA-MMA- 225,000 340 d2 Tetrahydro phthalic arhydride c3 -MAA-(N-phenyl m: "inide)- 10,000 300 d3 IRGANOX 3114 [0041] However, IRGANOX3114; tris -(3, 5-G t-butyl-4-hydroxybenzyl)- Isocyanurate (the Ciba-Geigy make, trade name) [0042]

table 4 Example of a comparison c1 c2 c3 d1 d2 d3 1 10 1 2 10 1.5 3 10 1 0.5 (solid weight

on the 80-degree C hot plate. Then, KAYAMIRROR in DVL-TS00 (organic alkalis system developer; the Nippon Kayaku make, trade name), after development and rinsing desiccation, postbake was carried out for 5 minutes on the 200-degree C hot plate, and the red detailed pixel was formed. Subsequently, pigment-content powder color NEGAREJISUTO KAYAMIRROR DCF-B630 (blue pigment resist: the Nippon Kayaku make, trade name) was applied to thickness by about 1 micrometer, and the ultraviolet rays of 150m/s)s (365m) were irradiated through the predetermined pattern photo mask after prebake for 100 seconds on the 80-degree C hot plate. Then, KAYAMIRROR Postbake was carried out for 5 mirutes on the 200-degree C hot plate after development and rinsing desiccation in DVL-T500 (organic alkali system developer; the Nippon Kayaku make, trade name), the red detailed pixel was formed, and the solid state image sensor with which direct attachment of the color filter was carried out was obtained. When this was observed from right above under the microscope, ***** to a substrate flattening film top and residue contamination were not accepted at all. accepted at all.

accepted at all.

[0045] On example 12 glass substrate, it is pigment—content powder color NEGAREJISUTO
KAYAMIRROR. On the coloring resin film which carried out pattern formation of the pixel of
KAYAMIRROR. On the coloring resin film which carried out pattern formation of the pixel of
KAYEMIRROR. On the coloring resin film which carried out pattern FR830, DCF—G830,
and DCF—8630 (red, green, a blue pigment resist; the Nippon Kayaku make, trade name), with
the resin constituent for transparence thin films of examples 1=10, the transparence thin film
was formed as a protective coat, and the color filter for LCD was created. When the crosscut friction test estimated the adhesion of each protective coat, all checked firm adhesion by
0/100 exfoliations. Moreover, as for the wrikle approach phenomenon, neither was seen,
although it applied at 250 degrees C on these color filters for 30 minutes and vacuum

II % of the weight of solid content by the ratio which shows respectively the copo note which to solve distinct by the ratio which shows respectively the copyrimental notecular compound of the (A) group shown in one to example 10 table 1, and the high rular compound of the (B) group in Table 2, and the resin constituent for transparence thin films was prepared. [0030]

[0030]
table 1 (A) Group MW WPE (B) Group MW a1 G-2050M 225,000 340 b1 GSM-1001 10,000 a2
-GMA-MMA-100,000 240 b2 GSM-8001 80,000 a3 -GMA-BMA-300,000 1000 b3 GSM10001 100,000 a4-GMA-AN-150,000 500 b4 Formula (1) 50,000 a5 -GMA-ST-400,000 2500
55 Formula (2) 25,000 [0031] However, GMA; gycidyl methacrylate, MMA; methyl
methacrylate, G-2050 M:GMA-MMA copolymer (Nippon 01 & Fats make, trade name), BMA:
butyl methacrylate, AN acrylonitrile, ST; styrene, and GSM-1001; styrene-maleic-acid
anhydride 1:1 copolymer (the product made from the Gifu shellae, trade name), CSM-6001;
styrene-maleic-acid anhydride 1:1 copolymer (the product made from the Gifu shellae, trade
name), CSM-1001; styrene-maleic-acid anhydride 1:1 copolymer (the product made from the
Gifu shellae, trade name) is expressed. [0032]

Table 2 Example a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 b4 b5 1 10 3 2 10 4 3 10 2 4 10 35 10 2 6 102 7 10 38 10 2 9 10 310 103 (solid weight ratio)
[0033] It carried out so that evaluation of the solvent resistance of the hardening film

(0034) It applied so that it might become the 0.5 micrometers of the last thickness on the example glass substrate of creation of the hardening film of the resin constituent for transparence thin films, and it heated for 5 minutes on the 200-degree C hot plate after prodying for 100 seconds on the hot plate with a skin temperature of 100 degrees C, and the transparence thin film was obtained. Let this be various test pieces.

[0035] Solvent resistance: The thickness before and behind processing and a trial was measured for the above-mentioned test piece on various conditions to the following solvent, it asked for the remaining rate of membrane, and the film surface was observed with the optical microscope.

50 degree-CIPA (isopropanol) steamy *20 minute exposure **50 degree-CIPA(isopropanol) steamy *20 minute exposure **50 degree-CIPA (isopropanol) steamy **50 degree-CIPA (is pigment-content powder color NeuAncilisUT (NATAMINTUR UD-10-13) (green-pigmen resist; — the Nippon Kayaku make —) A trade name is applied to thickness by about 1 micrometer. On a 80-degree C hot plate After the prebake during 100 seconds, It is KAYAMIRROW with ultraviolet-rays un-incrediating. Negatives were completely developed in DVL-TS00 (organic alkali system developer; the Nippon Kayaku make, trade name), and ******** (deltaReab value) to an after [insing desication] transparence thin film top was measured with the spectrophotometer. Moreover, the microscope estimated residue constraints of the constraints of the constraints of the constraints.

measured with the spectrophotometer. Moreover, the microscope estimated residue contamination. In the solvent so that it might become 11% of the weight of solid content with the compounding ratio shown in Table 4 as a resin constituent for transperence thin films which combined the thermosetting reain shown in one to example of comparison 3 table 3, and a curing agent. Evaluation of solvent resistance, a water resisting property, thermal resistance, residue contamination was performed like the above. An evaluation result is shown in Table 5.

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2005/09/26

JP,2000-248052,A (DETAILED DESCRIPTION)

8/8 ページ

evaporationo actuation of ITO was performed.

[0046] [Effect of the Invention] By using the resin constituent for transparence thin films of this invention, the transparence thin film excellent in thermal resistance, chemical resistance, a water resisting property, a dye affinity-proof, and adhesion can be manufactured simple. Especially on the occasion of formation of the protective layer of the coloring resin film of the color filter for LCD or the flattening layer of CCD, an interlayer, and a protective layer, it is useful. Moreover, since there are very little time of hest curing of the resin constituent concerned and process contamination at a back process, a reliable transparence thin film can be obtained by low cost, and the obtained color filter and a solid state image sensor can secure the outstanding display grace. Moreover, the color filter which prepared this transparence thin film has the outstanding optical property, and the outstanding electrical property and can offer a qualify electrochromatic display and a quality solid state image sensor by using this color filter.

[Translation done.]

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.